両親媒性分子集合体の構造解析と物性

首都大院理工 加藤 直

1. はじめに

- 2. 両親媒性分子と水が作る集合体の特徴と散乱法
- 3. 非イオン界面活性剤/水系におけるラメラ相の構造変化と相挙動

両親媒性分子の例





両親媒性分子集合体の形と表面曲率



両親媒性分子が水中で作る集合体



散乱法 → 波長と散乱角を変えることによって 広い空間スケールと時間スケールをカバー

可視光: 450~650 nm X線•中性子線: 0.1~1 nm (1nm = 10⁻⁹ nm)

光散乱	「静的光散乱	(SLS)
	動的光散乱	(DLS)

X線小角散乱 (SAXS) 中性子小角散乱 (SANS)







$$q = \frac{4\pi \sin \theta}{\lambda}$$

$$d = 2\pi n/q$$

	λ/nm	2 <i>θ</i> /°	d
X線小角散乱 (SAXS)	0.15	0.2~7	1 ~40 nm
中性子小角散乱 (SANS)	0.5 ~1.2	0.05 ~20	1 ~ 1000 nm
光散乱	450~650	20~150	0.2 ~2 μm
小角光散乱 (SALS)	450~650	3 ~20	2 ~10 µm



両親媒性分子集合体の特徴



相転移の複雑性:転移の際に構成単位の形が変化 ただし1つの相の中でも連続的な変化は起こる



T. Kato et al., *J. Phys. Chem.* (1986, '87, '90, '93), *Langmuir* (1994, '95), *J. Colloid Interface Sci.* (1996), *J. Mol. Liquid* (2001).



● nとmの組み合わせにより疎水性・親水性の調節が可能
 ● 温度変化のみ(第3物質なし)で種々の相に転移

 → 相転移過程の追跡が容易

 ● 親水基の¹Hの磁気緩和時間が長い

 → NMRによる自己拡散測定容易

温度によるポリオキシエチレン系界面 活性剤集合体の表面曲率の変化



両親媒性分子集合体の構造解析と物性

首都大院理工 加藤 直

1. はじめに

- 2. 両親媒性分子と水が作る集合体の特徴と散乱法
- 3. 非イオン界面活性剤/水系におけるラメラ相の構造変化と相挙動

非イオン界面活性剤/水系における ラメラ相の構造と相挙動

共同研究者: 嶺脇広二 研究協力者: 吉田博久(都立大工), 今井正幸(お茶大理) 伊藤和輝(高エネ研)

K. Minewaki, T. Kato, H. Yoshida, M. Imai, and K. Ito

"Small Angle X-ray Scattering from the Lamellar Phase Formed in a Nonionic Surfactant ($C_{16}E_7$)-Water System. Analysis of Peak Position and Line Shape."

Langmuir, **17**, 1864-1871 (2001).

非イオン界面活性剤C₁₆E₇濃厚水溶液の構造変化*



SAXS Patterns in C16E7/Water System



ラメラ相における繰返し距離の濃度依存性



X線小角散乱強度の解析



$$l(q) = \frac{2\pi}{d} \frac{P(q)S(q)}{q^2}$$

$$P(q): 2分子膜の形状因子* \leftrightarrow \delta_{hc}, \delta_{eo}$$

$$S(q): 構造因子* \leftrightarrow d, \eta$$

$$d: 繰返距離(平均値)$$

$$\eta : 繰返距離(平均値)$$

$$\eta : 繰返距離のゆらぎ$$

$$P(q) \propto \frac{1}{q^2} \rightarrow l(q) \propto \frac{1}{q^4}$$

$$\rightarrow q^4 l(q) \mathcal{E} 最小二乗fitting$$
* F. Nallet, R. Laversanne, and D. Roux,

J. Phys. II France, **3**, 487 (1993) (applied to AOT-water and DDAB-water)

Results of Least-Square Fittings of SAXS patterns



 $q^{4}I(q)$







 $C_{16}E_6$ /water system

optical microscopy

small-angle X-ray scattering

HNMR

random mesh phase

or defected lamellar phase



Figure 11. Schematic representation of the formation of a pore via a dimple in the $L_{\alpha}{}^{H}$ phase as the temperature is lowered from the classical lamellar phase.

S.S. Funari, M.C. Holmes, G.J.T. Tiddy, *J. Phys. Chem.*, **98**, 3015 (1994). C. E. Fairhurst, M.C. Holmes, M.S. Lever, *Langmuir*, **13**, 4964 (1997) X線小角散乱曲線の例





C₁₆E₇/water ラメラ相からのX線小角散乱

膜の向きと小角X線回折





M. Imai, A. Kawaguchi, A. Saeki, K. Nakaya, T. Kato, K. Ito, and Y. Amemiya, *Phys. Rev. E.*, **62**, 6865 (2000).



$$\phi_{\rm hc} = \frac{2\delta_{\rm hc}}{d}$$

 $\phi_{\rm hc} = \frac{2\delta_{\rm hc}(1-f_w)}{d}$

f_w: 膜内の欠陥の体積分率





非イオン界面活性剤C16E7/水系の相挙動と各相の構造

ラメラ相の構造の濃度・温度依存性



両親媒性分子集合体の特徴



相転移の複雑性: 転移の際に構成単位の形が変化ただし1つの相の中でも連続的な変化は起こる

ある程度の条件変化には柔軟に対応し、限度を超えると相転移(不連続な変化)が起こる

ラメラ相の構造の濃度・温度依存性



